



ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ

МАГНА ТМ 22

Назначение:

Нанесение многокомпонентных и многослойных металлических и диэлектрических тонких плёнок на подложки (пластины) методом магнетронного распыления.

Особенности:

- Групповая обработка подложек $\varnothing 76$ мм или $\varnothing 100$ мм;
- Шлюзовая камера для загрузки – выгрузки подложек;
- Планетарный двухступенной подложкодержатель;
- Предварительный нагрев подложек и их очистка с помощью источника ионов в шлюзовой камере;
- Нанесение пленок в рабочей камере одним, двумя, тремя, четырьмя магнетронами;
- Безмасляная (сухая) откачка на базе форвакуумного и криогенного насосов;
- Микропроцессорная система управления;
- Мощность потребления не более 20 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой $\sim 2,5$ м².

